



Progetto "iENTRANCE@ENL - Infrastructure for ENergy TRAnsition aNd Circular Economy @ EuroNanoLab" - Codice: IR0000027 - CUP: B33C22000710006 - Missione 04 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.1 "Rafforzamento e creazione di IR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - NextGenerationEU

PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS N. 33 DEL 14 MARZO 2013, MODIFICATO DALL'ART. 18

DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016

COME INTEGRATO DALL'ART.1 C. 145 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160,

DEI QUESITI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI SEGUITO INDICATO

NELLA RIUNIONE IN DATA - 04 OTTOBRE 2024

BANDO N. 400.10 IMEM PNRR

Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 141 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, di 1 (una) unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello, presso l'Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo (CNR-IMEM) sede secondaria di Trento (CUP B33C22000710006)

ESTRATTO – B

1) La candidata/Il candidato descriva la propria esperienza come attività di ricerca, anche in riferimento alle tematiche del bando.

The candidate/candidate describes her/his research activity experience, also in relation to the themes of the call.

2) La candidata/Il candidato descriva le principali caratteristiche della Atomic Layer Deposition e delle tecniche di litografia ed etching.

The candidate/candidate describes the main characteristics of Atomic Layer Deposition (ALD) and lithography techniques.

ESTRATTO – A

1) La candidata/Il candidato descriva la propria esperienza come attività di ricerca, anche in riferimento alle tematiche del bando.

The candidate/candidate describes her/his research activity experience, also in relation to the themes of the call.

2) La candidata/Il candidato descriva le basi dei processi di micro e nanofabbricazione in silicio e delle tecniche di deposizione di film sottili.

The candidate/candidate describes the fundamentals of silicon micro- and nanofabrication processes and of thin film deposition techniques.

NON ESTRATTO – C

1) La candidata/Il candidato descriva la propria esperienza come attività di ricerca, anche in riferimento alle tematiche del bando.

The candidate/candidate describes her/his research activity experience, also in relation to the themes of the call.

2) La candidata/Il candidato descriva le tecniche di litografia, etching, litografia maskless a scrittura diretta con laser ed una tecnica di deposizione di film sottili.

The candidate/candidate describes the techniques of lithography, etching, laser-written maskless lithography and an example of thin film deposition

IL PRESIDENTE

Prof. Lucio Pancheri

La SEGRETARIA

Dr.ssa Laura Parellada Monreal